

## บทที่ 3

### วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลอง

#### 3.1 สารเคมีและอุปกรณ์

##### 3.1.1 สารเคมี

- 1) Bismuth chloride, BiCl<sub>3</sub>, MW = 345.34
- 2) Bismuth nitrate, Bi(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>•5H<sub>2</sub>O, MW = 485.11
- 3) Silver nitrate, AgNO<sub>3</sub>, MW = 169.87
- 4) Thiosemicarbazide, CH<sub>5</sub>N<sub>3</sub>S, MW = 91.13
- 5) Thioacetamide, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>NS, MW = 75.13
- 6) Thiourea, CH<sub>4</sub>N<sub>2</sub>S, MW = 76.12
- 7) N-cetylpyridinium chloride, C<sub>21</sub>H<sub>38</sub>ClN, MW = 339.99
- 8) Ethylene glycol, C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>, > 95%
- 9) Deionized water
- 10) Ethanol, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH, 95%
- 11) Absolute ethanol, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH, 99.0-100.0%

##### 3.1.2 อุปกรณ์

- 1) Hotplate & magnetic stirrer, model 502P-2, PMC Industries, Inc., San Diego, America
- 2) เครื่องเขย่าสาร โอดิไซด์สีเงินความถี่สูง, Branson, model 1510E-DTH
- 3) เตาอบ, model UE-400, Memmert, Germany
- 4) เตา ไมโครเวฟ, Electrolux model 2820S
- 5) X-ray Diffractometer, model D500/501, Siemens, Germany
- 6) Perkin Elmer Luminescence spectrometer, model LS50B, Germany
- 7) UV - Vis Spectrometer, model UV-2401PC, Germany
- 8) Scanning Electron Microscope, model JSM-6335, JEOL, Japan
- 9) Transmission Electron Microscope, model JEM-2010, JEOL, Japan

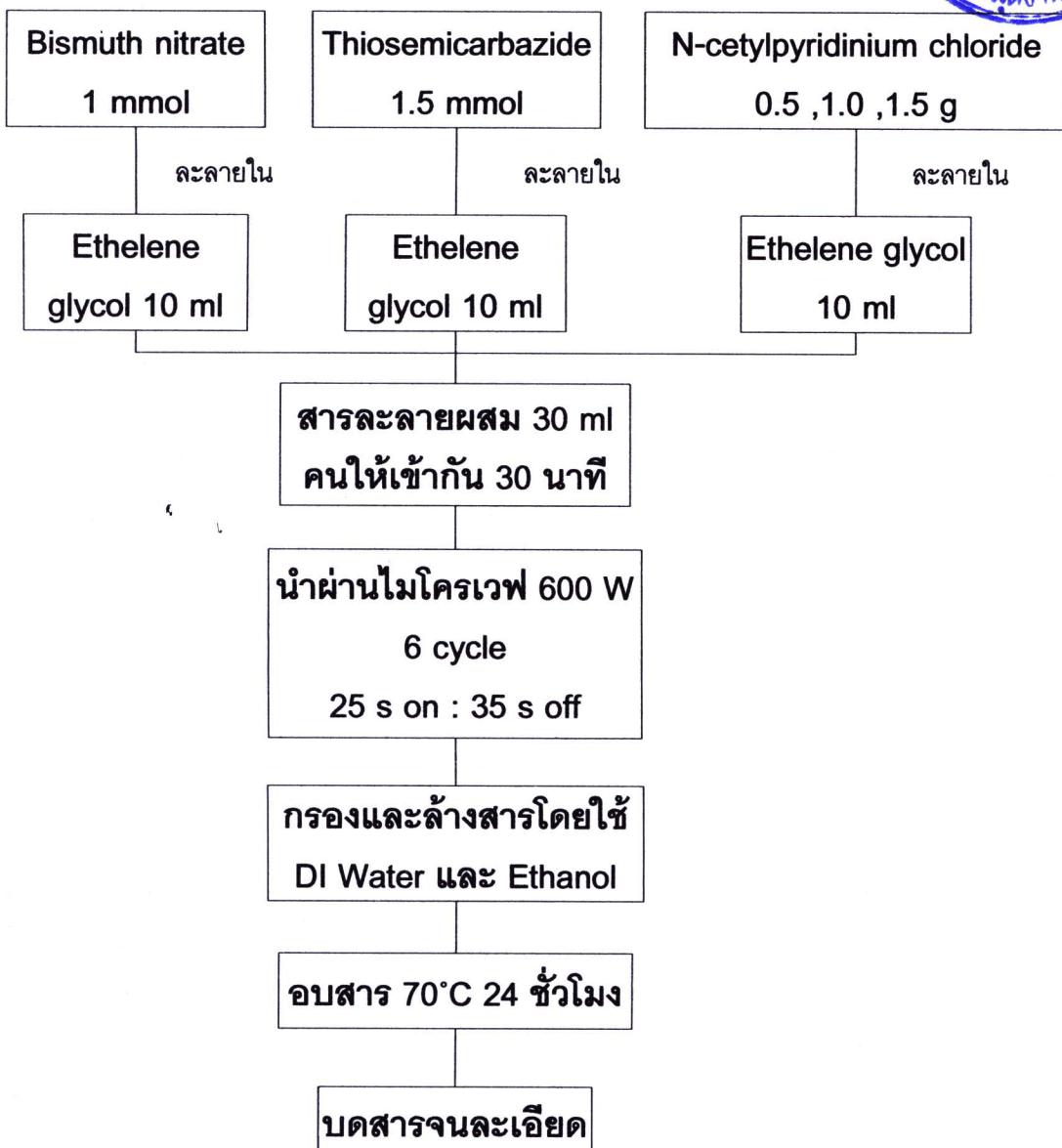
### 3.2 การสังเคราะห์สาร

#### 3.2.1 การสังเคราะห์ $\text{Bi}_2\text{S}_3$ โดยเทคนิคในโคลเวฟ

เติม bismuth nitrate 0.002 mole และ thiosemicarbazide 0.003 mole แยกกันละลายใน ethylene glycol 10 ml จากนั้นละลาย surfactant N-cetylpyridiniumchloride ในปริมาณต่างกันละลายใน ethylene glycol 10 ml แล้วจึงนำไปผสมกับสารละลายทั้งสองข้างต้น ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 จากนั้นนำสารละลายที่ผสมแล้วคนให้เข้ากันด้วยเครื่อง magnetic stirrer แล้วนำเข้าเตาในโคลเวฟเพื่อให้ความร้อนแก่สารโดยใช้กำลังไฟฟ้า 600 W อบสาร 6 cycle โดย 1 cycle คือเปิดเครื่อง 25 วินาทีและปิดอีก 35 วินาที จากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นภายใต้อุณหภูมิห้อง แล้วจึงนำสารสีดำที่ตกตะกอนไปกรองแล้วล้างด้วย deionized water และ ethanol เพื่อล้างสิ่งเจือปนออกและนำไปอบที่อุณหภูมิ 65°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นจึงนำผงของสารไปวิเคราะห์ต่อ

ตาราง 3.1 การเติมสารในเรือนไขต่างๆ เพื่อสังเคราะห์  $\text{Bi}_2\text{S}_3$

| surfactant                | ปริมาณ surfactant (g) |
|---------------------------|-----------------------|
| -                         | 0                     |
| N-cetylpyridiniumchloride | 0.5                   |
|                           | 1.0                   |
|                           | 1.5                   |



รูปที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการสังเคราะห์  $\text{Bi}_2\text{S}_3$

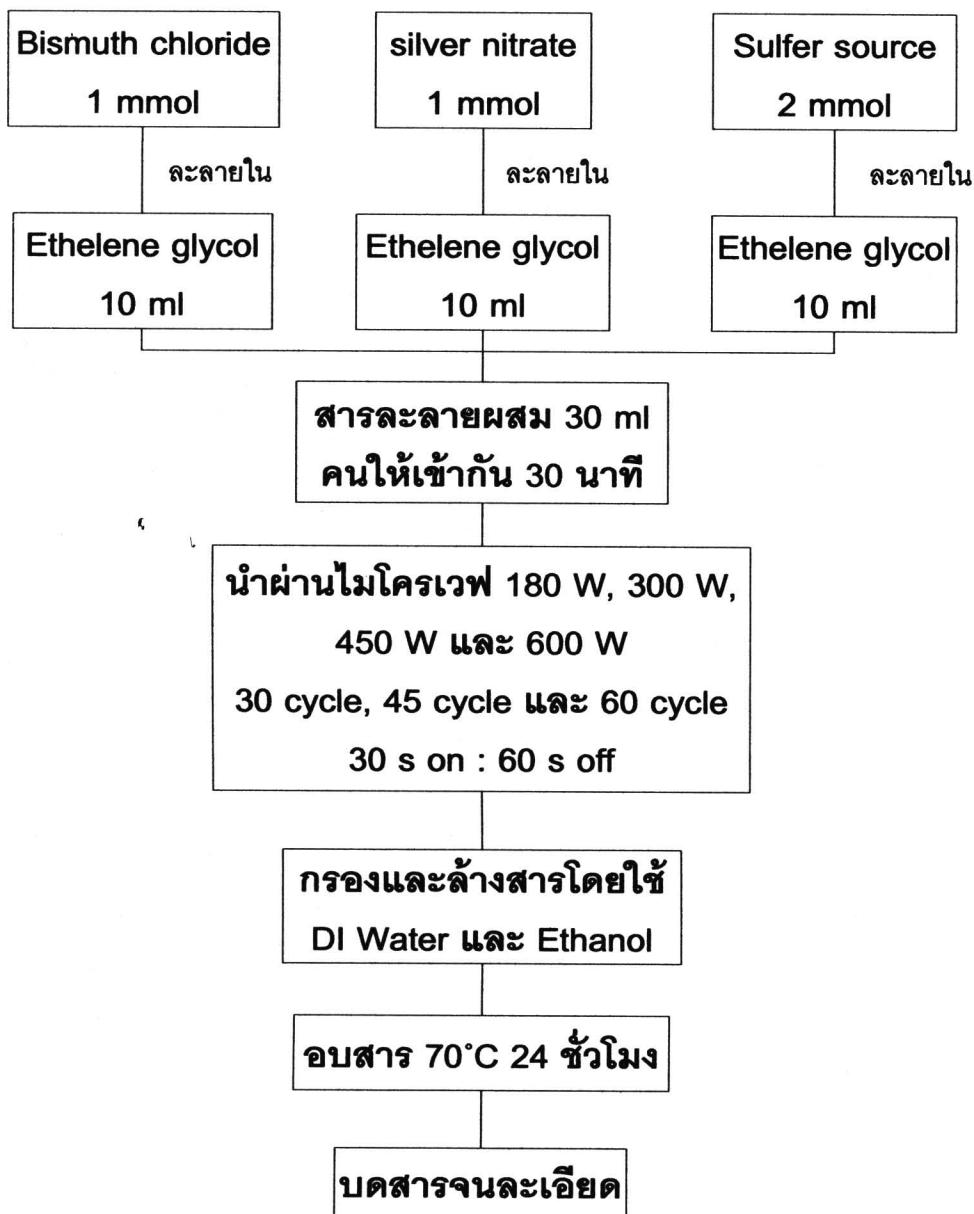
### 3.2.2 การสังเคราะห์ $\text{AgBiS}_2$ โดยเทคนิคไมโครเวฟ

เตรียม siver nitrate 0.001 mole และ bismuth chloride 0.001 mole แยกกันละลายใน ethylene glycol 10 ml จากนั้นละลาย sulfur source ชนิดต่างๆปริมาณ 0.002 mole ใน ethylene glycol 10 ml แล้วจึงนำไปผสมกับสารละลายทั้งสองข้างต้นจากนั้นนำสารละลายที่ผสมแล้วคนให้เข้ากันแล้วจึงนำเข้าเตาไมโครเวฟเพื่อให้ความร้อนแก่สารโดยใช้กำลังไฟฟ้าต่างกัน ในเวลาต่างกันโดย 1 cycle คือเปิดเครื่อง 30 วินาทีและปิดอีก 60 วินาที ดังตารางที่ 3.2 จากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นภายใต้

อุณหภูมิห้อง นำสารสีดำที่ตกตะกอนไปกรองและล้างด้วย deionized water และ ethanol เพื่อล้างสิ่งเจือปนออก จากนั้นจึงนำไปอบที่อุณหภูมิ 65°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมงแล้วจึงนำผงของสารไปวิเคราะห์ต่อ

ตาราง 3.2 การเตรียมสารในเงื่อนไขต่างๆ เพื่อสังเคราะห์  $\text{AgBiS}_2$

| Sulfur source | Power (W) | จำนวน cycle |
|---------------|-----------|-------------|
| thioacetamide | 180       | 30          |
|               |           | 45          |
|               |           | 60          |
|               | 300       | 30          |
|               |           | 45          |
|               |           | 60          |
|               | 450       | 30          |
|               |           | 45          |
|               |           | 60          |
|               | 600       | 30          |
|               |           | 45          |
|               |           | 60          |
| thiourea      | 180       | 30          |
|               |           | 45          |
|               |           | 60          |
|               | 300       | 30          |
|               |           | 45          |
|               |           | 60          |
|               | 450       | 30          |
|               |           | 45          |
|               |           | 60          |
|               | 600       | 30          |
|               |           | 45          |
|               |           | 60          |

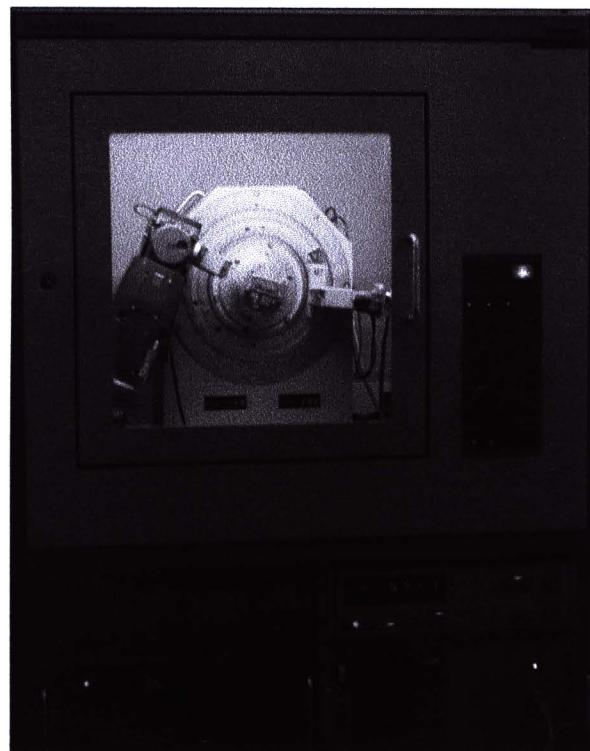


รูปที่ 3.2 แสดงขั้นตอนการสังเคราะห์  $\text{AgBiS}_2$

### 3.3 การทดสอบคุณลักษณะของสารที่สังเคราะห์

#### 3.3.1 วิเคราะห์ โครงสร้างของสารที่ได้ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction, XRD)

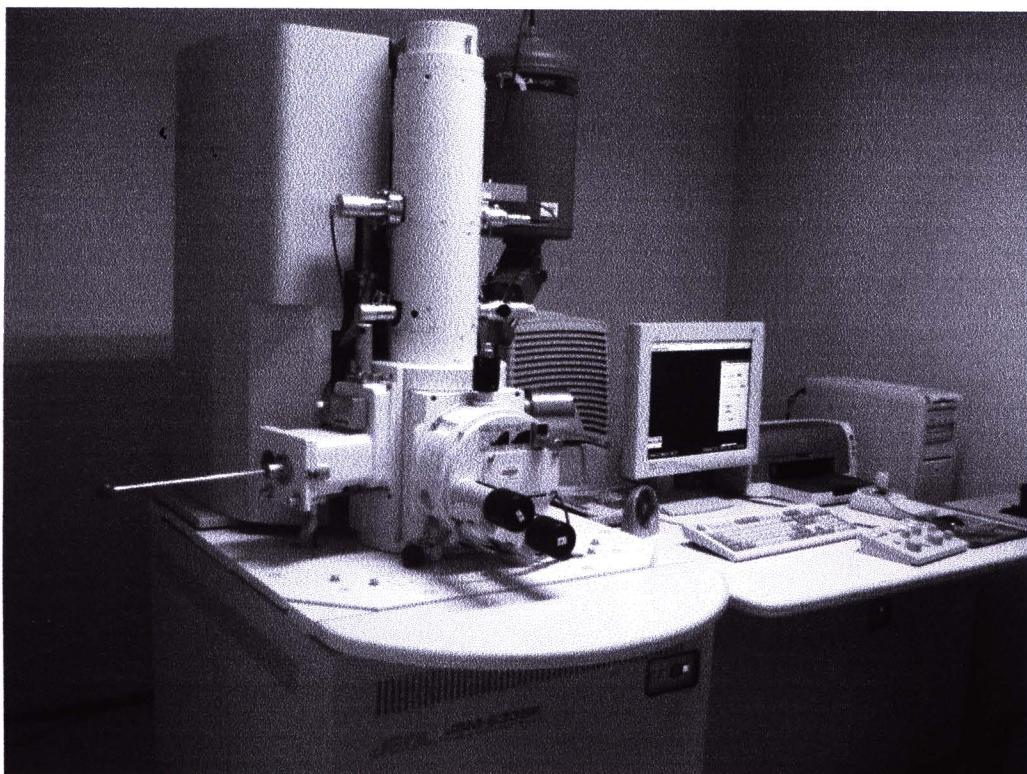
เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction, XRD) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างผลึกโดยไม่ทำลายตัวอย่าง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถดูโครงสร้างภายในของสารได้ ทางการศึกษาใช้ Bragg's equation ที่มีรูปแบบ  $2d \sin \theta = n\lambda$  ที่  $d$  คือระยะห่างระหว่างองค์ประกอบในโครงสร้าง  $\theta$  คือ 각ที่รังสีเจ风雨ตัวอย่าง  $n$  คือจำนวนเต็ม และ  $\lambda$  คือความยาวคลื่นของรังสี X-ray ที่ใช้ เช่น สำหรับรังสี Cu K $\alpha$  ที่  $\lambda = 0.15418 \text{ \AA}$  การวิเคราะห์จะต้องคำนึงถึงความแม่นยำของผลลัพธ์ ดังนั้นจึงต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เช่น X-ray diffractometer ที่มีความแม่นยำสูง เช่น Bruker D8 Advance ที่มีความละเอียด 0.02° และความแม่นยำ ± 0.01° ในการวัด각  $\theta$  ที่ต้องการ กระบวนการวิเคราะห์จะเริ่มต้นด้วยการติดตั้งตัวอย่างลงบนชุดหมุน (sample stage) แล้วนำรังสี X-ray ผ่านชุดหมุนและตัวอย่าง แล้วบันทึกผลลัพธ์เป็นรูปภาพที่เรียกว่า diffractogram ที่แสดงถึงความถี่ของการ反射รังสีตาม 각ที่ต่างๆ ที่ต้องการ แล้วนำ diffractogram ไปเทียบกับฐานข้อมูลของโครงสร้างที่มีอยู่แล้วในห้องปฏิบัติการ หรือในห้องสมุดทางวิทยาศาสตร์ เช่น JCPDS หรือ ICDD เพื่อหาโครงสร้างที่เหมาะสมที่สุด



รูปที่ 3.3 X-ray diffractometer

**3.3.2 วิเคราะห์ลักษณะของสารโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด field emission-scanning electron microscope (FE-SEM)**

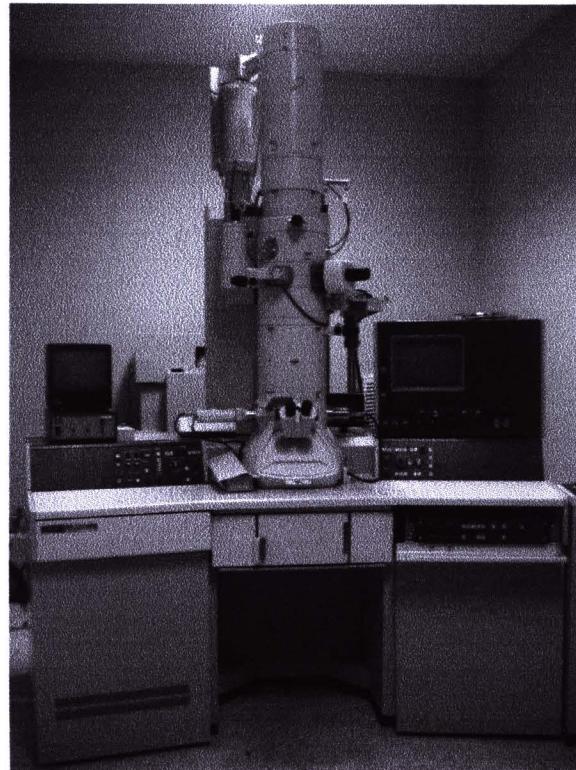
เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ใช้ในการศึกษารายละเอียดของพื้นผิวตัวอย่างเหมาะสำหรับการสร้างภาพของกลุ่มสัญญาณในการศึกษาโครงสร้างลักษณะพื้นผิวด้านนอกมีแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนแบบ cold cathode field emission มีความแยกชัดสูงถึง 0.15 nm ที่ 15 kV ศักย์เร่งอิเล็กตรอนปรับเปลี่ยนได้ในช่วง 0.5-30 kV



รูปที่ 3.4 scanning electron microscope

**3.3.3 วิเคราะห์ลักษณะของสารโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน transmission electron microscope (TEM)**

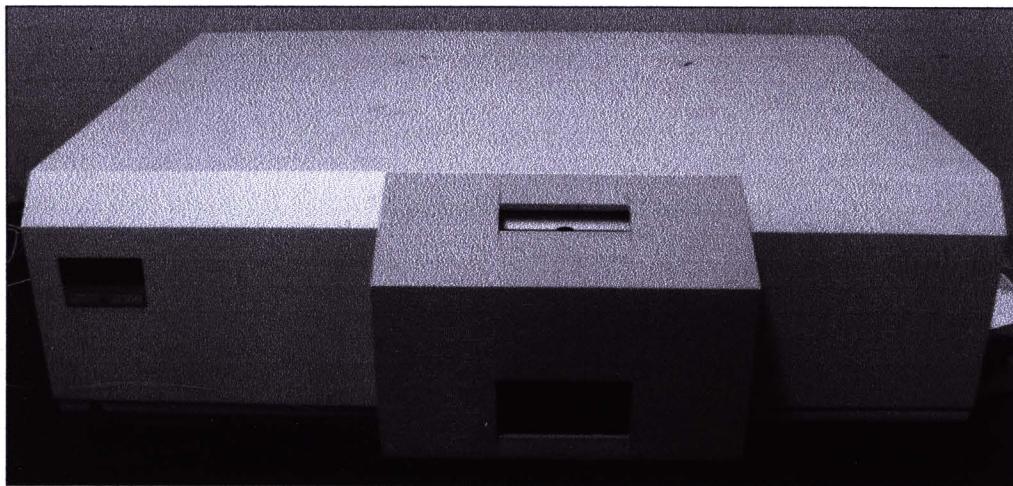
ขนาดและลักษณะของอนุภาคสามารถตรวจสอบได้โดยใช้ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ความต่างศักย์ 20 kV เร่งอิเล็กตรอนทำให้อิเล็กตรอนสามารถทะลุผ่านชั้นงานได้ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนที่ทะลุผ่านบริเวณต่าง ๆ ของชั้นงานจะแตกต่างกัน เมื่ออิเล็กตรอนตกกระแทบบนขอเรืองแสงจึงทำให้เกิดภาพฉายที่สามารถใช้ศึกษาลักษณะวิทยาหรือความบกพร่องของโครงสร้างอะตอนของชั้นงานได้และยังสามารถวิเคราะห์โครงสร้างผลึกจากแบบรูปการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน



รูปที่ 3.5 transmission electron microscope

#### 3.3.4 วิเคราะห์ luminescence emission spectra

สามารถตรวจสอบการเรืองแสงของสาร โดยใช้เครื่อง luminescence spectrometer ทดสอบในอุณหภูมิห้อง โดยให้คลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นตั้งแต่ 200 – 1000 nm เพื่อวัดค่าการสูญเสียและ การปลดปล่อยพลังงานของสาร ในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ



รูปที่ 3.6 luminescence spectrometer

### 3.3.5 วิเคราะห์ UV-Vis absorption spectrum

UV-Vis spectrophotometer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณแสงในช่วงรังสีขรุ่ว และช่วงแสงขาวที่ทะลุผ่านหรือถูกคุกคักโดยตัวอย่างที่วางอยู่ในเครื่องมือ ความยาวคลื่นแสงจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณและชนิดของสารที่มีอยู่ในตัวอย่างซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อน และสารอนินทรีย์ที่สามารถคุกคักแสงในช่วงความยาวคลื่นเหล่านี้